

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバーである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。若手技術者とベテラン技術者とのFace to faceの活発な議論を期待して、下記の要項で第5回ポスター展を開催する。

## 若手のポスター発表展 ーベテランとの議論に打ち勝て！ー

- 主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2020年3月13日（金） 13：00～17：00
- 場所：主婦会館プラザエフ  
JR 四ツ谷駅 麴町口から徒歩1分  
(〒102-0085 東京都千代田区六番町15)
- 参加者は会費3,000円になります。 <https://forms.gle/QAtmyKpEGq1iR4jN6>  
発表者および学生は会費無料になります。
- 申込締切：2019年3月3日（火）
- 定員：60名 ※定員に限りがあるので早めに参加お申込みください。
- プログラム：
  - (1) 13：00～13：10 「開会の辞」 企画：蔦野恭平（オルガノ）
  - (2) 13：10～14：00 「2分間ショートプレゼン」  
14：00～14：20 （休憩・会場準備）
  - (3) 14：20～16：00 「ポスターセッション」  
16：00～16：20 （休憩・会場準備）
  - (4) 16：20～16：40 「INE活動報告」総務責任者：吉水康人（キオクシア）
  - (5) 16：40～16：50 「表彰」 委員長：富田 寛(キオクシア)
  - (6) 16：50～17：00 「閉会の辞」 副委員長：岩元 勇人(ソニーセミコンダクターソリューションズ)
  - (7) 17：00～17：10 「写真撮影」  
17：10～17：30 （休憩・会場準備）
  - (8) 17：30～19：30 「懇親会（カサロス）」（ポスター展と同じ会場）

### ■ 参加の申込方法：

URLもしくはQRコードより、アンケートにご回答する形でお申し込みをお願い致します。  
<https://forms.gle/QAtmyKpEGq1iR4jN6>

ソニーセミコンダクターソリューションズ 萩本賢哉 Yoshiya.Hagimoto@sony.com  
オルガノ 蔦野恭平 tsutano-k@organo.co.jp  
日本インテグリス 永淵琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com



■ ポスターセッション

タイトル	発表者	所属 (五十音順)
1 逆電圧印加による高圧スプレー洗浄時の発生電荷の低減	福岡 靖晃	愛知工業大学
2 超音波振動体型洗浄装置を用いたサブミクロンポリスチレンラテックス粒子の除去評価	村上 良輔	愛知工業大学
3 Optimized combination of ion exchange resins for the removal of trace amount of metal impurities from isopropyl alcohol	久野 智子	オルガノ株式会社
4 化学エッチングを利用した燃料電池用ナノカーボン触媒の単一レベル活性評価	小笠原 歩見	大阪大学
5 重アンモニアガスを用いた高信頼性メモリセル絶縁膜の形成	野口 将希	キオクシア株式会社
6 機能水によるLa <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 溶解抑制洗浄	杉田 航	栗田工業株式会社
7 静止及び回転時におけるPVAブラシと表面との相互作用 ～表面近傍におけるブラシの存在割合～	保坂 篤紀	静岡大学
8 回転中ウエハー上のPVAロールブラシ変形観察 ～ブラシ吸排水によるナノ粒子高効率流体洗浄にむけて～	宮木 翼	静岡大学
9 ウェットによるCu recess技術	秋山 勝哉	株式会社 SCREENセミコンダクターソリューションズ
10 表面改質を利用した乾燥技術	山口 佑	株式会社 SCREENセミコンダクターソリューションズ
11 InGaAs表面におけるWETプロセスを用いた原子層エッチングの反応メカニズム	平野 智暉	ソニーセミコンダクタソリューションズ 株式会社
12 枚葉スピン方式を用いたフッ硝酸Siエッチングにおけるソーマーク段差解消メカニズムの解明	深谷 天	ソニーセミコンダクタソリューションズ 株式会社
13 新規添加剤による優れたウエハー清浄性の発現メカニズムに関する考察	三木 翼	株式会社ダイセル
14 ポリイミド多孔質膜におけるフォトポリマー吸着特性	平野 勲	東京応化工業株式会社
15 Wet Etching Inside Advanced High Aspect Ratio Structures: Impact of Dissolved Oxygen	坂崎 哲也	東京エレクトロン九州株式会社
16 有機溶剤からの金属除去機構の検討	永淵 琢也	日本インテグリス合同会社
17 Cu-CMP洗浄後におけるCu表面状態の評価	草野 智博	三菱ケミカル株式会社

## 第28回カサロス（懇親会）

- 主催：応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会
- 日時：2020年3月13日（月） 17：30～19：30
- 場所：主婦会館プラザエフ  
（〒102-0085 東京都千代田区六番町15）  
《交通》JR 四ツ谷駅 麹町口から徒歩1分
- 参加費：5,000円 当日参加7,000円（学生 無料）  
※カサロス会費について当日会場にてお支払い下さい。  
領収書を発行します。

■申込締切：2020年3月3日（火）

### ■申込方法

以下URLもしくはQRコードより、  
お申し込みをお願い致します。  
参加申込書は、ポスター展、カサロス共通です。

<https://forms.gle/QAtmyKpEGq1iR4jN6>



アクセス不具合等ございましたら、メールにてお申し込みのお願い致します。

ソニーセミコンダクタソリューションズ 萩本賢哉 Yoshiya.Hagimoto@sony.com  
オルガノ 蔦野恭平 tsutano-k@organo.co.jp  
日本インテグリス 永淵琢也 takuya.nagafuchi@entegris.com

上記3名へメールにてお申込みのご連絡をください。